



## LUXBEAM® LITHOGRAPHY SYSTEM - LLS

LUXBEAM® LITHOGRAPHY SYSTEM - LLS – ADVANCED PACKAGING

# CD均匀性 和高效率

LUXBEAM® 光刻系统 (LLS) 是为设备制造商和工具制造商集成进下一代直接成像光刻系统的一套子系统。LLS支持先进封装，微光学和PCB加工等应用。

为了方便设备和工具厂商容易地将LLS集成到其设备和工具中，LLS包括了详细的接口文档和现场技术支持。

### 高效率

高功率UV紫外光输出，高速数据传输，实时图像处理，以及DLP技术的高刷新频率等几项技术相结合使该系统具有可以支持最先进的生产效率配置的能力。

### 高精度

基于光复用的自主专利技术，LLS可达到纳米级的拼接和边缘粗糙度，从而实现高精度。

### 低使用成本

DLP技术结合LED和激光二极管作为光源为LLS系统提供了超长的使用寿命和较低的使用成本。



### LUXBEAM® LITHOGRAPHY SYSTEM - LLS

#### 精度

- L/S: 2  $\mu$ m - 6  $\mu$ m

#### LED / Laser 波长

- LED 350 - 420 nm
- Laser 375 nm, 405 nm

#### 生产效率

- 200 面/小时

#### 自动对焦

- 1  $\mu$ m 精度 (快速线性电机)

#### 支持的基板厚度

- 没有限制

#### 冷却系统

- 无风扇水冷系统

# LUXBEAM® Lithography System - LLS

## – 先进封装

规格特性 / 型号	LLS 2500	LLS 04	LLS 06
精度	2,0 um Line /Space	4,0 um Line /Space	6,0 um Line /Space m
曝光时间*	Up to 50 sides / hour	Up to 100 sides / hour	Up to 200 sides / hour
光源	Laser diodes 405nm / 375*** nm	Laser diodes 405nm / 375*** nm	Multiple LED's 350nm – 420 nm
能量均匀性, PPC 校正**	>99%	>99%	>99%
CD 均匀性	>95%	>95%	>95%
外观尺寸	505 x 80 x 421 mm	505 x 80 x 421 mm	478 x 89 x 421 mm
总重量 (不含电源)	8 kg	8 kg	9 kg
功耗	500 W	500 W	950 W
冷却系统	Liquid cooling	Liquid cooling	Liquid cooling
内置相机	YES	YES	Option

系统	LLS 2500	LLS 04	LLS 06
软件	Complete API for Windows	Complete API for Windows	Complete API for Windows
最大基板尺寸	Unlimited	Unlimited	Unlimited
输入格式	GDSII, OASIS, ODB++, Gerber	GDSII, OASIS, ODB++, Gerber	GDSII, OASIS, ODB++, Gerber
基板数据和串号	User defined	User defined	User defined
缩放和对位	Supported	Supported	Supported
对位基准点数量	40.000	40.000	40.000

\* 300mm Wafer

\*\*PPC :Pixel power correction, patented